

115 年度

教育部『藝術與設計菁英海外培訓計畫』

數位動畫組、視覺傳達設計組、產品設計組、
建築與景觀設計組、時尚設計組

甄選簡章

主辦單位：教育部

官方網站：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>

承辦單位：國立雲林科技大學—數位動畫組、視覺傳達設計組、時尚設計組

地址：雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號

計畫總辦公室(產學研大樓 AI321)

電話：(05)534-2601 轉 6593

國立成功大學工業設計系—產品設計組

地址：臺南市大學路 1 號

光復校區工業設計系系辦

電話：(06)275-7575 轉 54343

國立成功大學建築學系—建築與景觀設計組

地址：臺南市大學路 1 號

成大創意基地(C-Hub)5F

電話：(06)275-7575 轉 50238

協辦單位：台南應用科技大學—時尚設計組(研習營)

地址：臺南市永康區中正路 529 號

服飾設計管理系系辦

目錄

章節	項目	頁數
	計畫簡章	1
	數位動畫組	8
	視覺傳達設計組	15
	產品設計組	22
	建築與景觀設計組	29
	時尚設計組	36
附錄一	2025 年語文檢定考試參考資料	42
附錄二	教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表	49
附錄三	國立雲林科技大學位置圖	53
附錄四	台南應用科技大學位置圖	54
附錄五	國立成功大學位置圖	55
附件	老師推薦函	56

115 年度教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」甄選簡章

壹、培訓期限：自 115 學年度起至 116 學年度止，共計國外進修培訓一年。

貳、申請資格：

113 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上或研究所碩士班在學學生(含進修學士班，但不含在職專班)，具有中華民國國籍，設有戶籍者，且從未獲本計畫選送出國之學生。出國進修前，須具備國內學校學生身分，國外進修培訓期間，亦需具備國內學校學生身分，包含保有學籍者。

參、申請對象：

一、報名管道：分成學校推薦、個人申請、獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者三種。

二、學校推薦：由學校推薦學業成績優異且具有出國學習潛力之學生報名申請。應於計畫網站之線上報名系統完成報名及上傳下列資料：(1)大學(含)以上在學成績單、(2)作品集、(3)語言能力證明影本(可以大學語言相關課程成績證明)、(4)其他有助於審查之證明文件與資料影本等規定之相關文件、(5)學校系所推薦公文及(6)老師推薦函(附件)，每系所每組以 10 名為限。

個人申請：個人申請由學生自行報名申請。應於計畫網站之線上報名系統完成報名及上傳下列資料：(1)大學(含)以上在學成績單、(2)作品集、(3)語言能力證明影本(可以大學語言相關課程成績證明)及(4)其他有助於審查之證明文件與資料影本等規定之相關文件。

獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：依據 114 年 5 月新一代設計展官方公告之得獎名單，由獲獎學生自行報名申請，應於計畫網站之線上報名系統完成報名及上傳下列資料：(1)作品集、(2)語言能力證明影本(可以大學語言相關課程成績證明)及(3)其他有助於審查之證明文件與資料影本。

肆、報名日期及方式：

一、報名日期：即日起至 114 年 5 月 28 日(星期三) 23:59:59 截止。

二、報名方式：線上申請 <https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad>
請依申請身分於報名截止時間前，於計畫網站之線上報名系統完成報名，系統於當日 23:59:59 自動截止關閉，逾時恕不受理。

伍、特別注意事項：

- 一、報名資格之認定以考生上傳之報名資料為準，不另做驗證；但複審或決審錄取報到時，須依報名時所填之報名資格繳驗相關學籍證明等文件正本。
- 二、報名前應詳閱簡章，確認自身是否具有報名資格，並僅能於「數位動畫組」、「視覺傳達設計組」、「產品設計組」、「建築與景觀設計組」及「時尚設計組」擇一組報名。報名後，不得因任何理由更改報名組別。
- 三、甄選期間所繳交之各項表件若有不符，或有抄襲、偽造、假借、塗改、矇混等情事，如經查實將取消甄選資格。
- 四、錄取報到後，須依規定日期前完成簽訂獎學金契約書始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。
- 五、本計畫獎學金之受獎學生於海外培訓機構所修得之學分，由受獎學生原就讀學校自行決定是否採計抵免原就讀學校學分。
- 六、為維持試務公平，本計畫複審錄取學員，不得私下自行聯繫或另行申請同組所列任一海外培訓機構，如經查獲將取消資格。

陸、初審第一階段國內研習營入選通知及第二階段國內研習營成績：

- 一、初審第一階段「國內研習營申請」預計錄取參加研習營人數：
 - (1) 學校推薦、個人申請：除時尚設計組依審查結果擇優錄取 20 名，備取 6 名外，其餘每組依審查結果擇優錄取 30 名，備取 10 名。
 - (2) 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：每組至多錄取 3 名。
- 二、初審第一階段結果(研習營錄取通知)將於 114 年 6 月 10 日(星期二)前(依實際公告日為主)以 E-mail 寄發，同時公告於計畫網站。
- 三、初審第二階段「國內研習營」邀請國內外講師授課評分，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。研習營期間另擇日安排面試。
- 四、初審第二階段「國內研習營」排序預計於研習營後一週內以 E-mail 寄發，同時公告於計畫網站(實際日期以承辦學校公告為準)。

柒、國內複審繳件與合格名單：

- 一、繳交海外培訓機構要求之外文語言門檻成績影本、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。3 年內得獎證明佔計分比例 10%，無則免繳。外文語言成績僅為國內複審名單審查門檻，不另計分。繳件期限詳見各組注意事項，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。
- 二、國內複審成績計算方式：初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+面試(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計總分。依據總分作為海外培訓機構志願依序分發之排序。
- 三、複審合格名單經複審會議決議後，於計畫網站公告、E-mail 通知，合格者得依照規定期限，另行繳交海外決選申請資料。
- 四、複審名單決選方式及語文能力審查原則：(一)先按學員總成績名次及所繳之志願表排序，以海外培訓機構錄取名額最多 4 倍；每位學員最多送審 2 所培訓機構為原則分發語言成績合格者。(二)首輪分發後，如有餘額得由複審委員評定，依總成績名次序遞補語言成績未達標準者，且以接近申請標準者優先，最多補至額滿。若總成績同分則依序以(1)「國內研習營成績」、(2)「初審成績」比較，擇優送審之。(三)各組另有頒布審查原則者，詳見各組注意事項。

捌、決選繳件及核定方式：

- 一、複審合格名單公布後，合格者需繳交海外培訓機構所規定之英文作品集、研習計畫、相關英譯表件資料及海外培訓機構要求之語文能力證明等。繳交日期則由各組承辦學校依海外學校期程另行公告。逾期繳件概不受理。
- 二、海外培訓機構之申請由各組承辦學校集中申請代辦，待海外培訓機構決選後由承辦學校直接公布獎學金得主。
- 三、實際錄取名單依據海外培訓機構決選結果而定，最多不得超過教育部獎學金核定名額；未通過海外培訓機構決選時，雖有名額亦不予錄取。
- 四、各海外培訓機構除依核定名額錄取正取生外得列備取生，依海外培訓機構之決選

結果為依據，並以名次排序，如有缺額則以名次依序遞補。

五、實際錄取名單依據海外培訓機構決選結果及承辦學校公告之名單為準。

玖、決選錄取及放榜公告：

一、預計於 115 年 6 月 12 日（星期五）前（確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整）於計畫網站公告錄取名單，並以 E-mail 寄發正、備取通知。

二、計畫網站：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>

三、恕不受理任何形式查榜。

拾、報到及相關契約：

一、正取生：

1. 報到日期：115 年 6 月 22 日（星期一）前或接獲錄取通知後一週內完成辦理報到。
2. 報到時間、方式另書於錄取通知及報到注意事項，並於網站公告。
3. 報到時應繳(驗)證件：正取通知與報到單、身分證正反面影本、學籍證明文件。
4. 未依規定日期辦理報到、未繳驗證件者或未完成簽約手續者，視為自願放棄，事後不得以任何理由要求補報到或補驗。
5. 正取生因自願放棄或未依規定完成報到、簽約手續，其缺額由同組辦理備取登記之備取生依名次高低依序遞補。
6. 學生於出國培訓前及培訓期間，需保有學生身分，倘失去學生身分即喪失培訓資格。

二、備取生：

1. 備取缺額公告日期：115 年 6 月 24 日（星期三）前。
2. 報到日期：115 年 6 月 26 日（星期五）前或接獲錄取通知後一週內完成備取登記及辦理報到。
3. 報到時間、方式另書於備取通知及報到注意事項，並於網站公告。
4. 報到時應繳(驗)證件：備取通知與報到單、身分證正反面影本、學籍證明文件。
5. 未依規定日期辦理報到、未繳驗證件者或未完成簽約手續者，視為自願放棄，事後不得以任何理由要求補報到或補驗。

三、凡經本甄選公告錄取者須配合承辦學校簽訂獎學金行政契約書，逾期未完成視為放棄。並依契約書內容及相關規定完成相關手續出國進修，逾期視為放棄，並取消錄取資格。簽約相關作業於錄取後另行通知。

四、凡經本甄選錄取，完成簽訂獎學金行政契約書者，其因進修所涉及之權利義務，悉依行政契約書及「教育部補助大專校院藝術與設計菁英海外培訓實施要點」規定辦理(以上契約書及相關規定，嗣後若經修正，除另有規定外，按新修正規定辦理)。

拾壹、補助費用標準：

一、對學生之獎助項目參照教育部公費留學標準，除學雜費及實習費外，原得申請項目費用如出國手續費、往返機票費、月支生活費、綜合補助費及健康保險費等併入年支生活費中，以簡化支領項目（如下表）。本計畫之受獎學生若因獲頒海外培訓機構之獎學金，將扣除海外培訓機構之獎學金後，給予實際支付之學費總額。

二、培訓機構進修及公司實習如非於同一城市，將各依該地區補助生活費且亦不額外補助交通費。生活費依實際進修月份支領，以一年為限。

三、下表生活費基準嗣後如有調整，請依教育部最新公告為主。

- | |
|---------------|
| 1. 學費：檢據核實發給。 |
|---------------|

2. 生活費：(單位：美元)			
地區/國家		城市或地區	年支生活費
美國	城市	紐約市(New York City)、舊金山市(San Francisco)	25,000
		洛杉磯市(Los Angeles)	24,000
		華盛頓特區(Washington, D.C.)、波士頓市(Boston)	23,000
		其他城市	22,000
加拿大			24,000
歐洲	城市	倫敦市(London)、巴黎市(Paris)	23,000
		威尼斯市(Venice)	22,000
歐洲	國家	盧森堡	25,000
		瑞典、瑞士	24,000
		比利時、冰島	23,000
		德國、挪威、丹麥	22,000
		英國、芬蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭	21,000
		法國、義大利、荷蘭	20,000
		其他歐洲國家	15,000
俄羅斯	城市	莫斯科市(Moscow)	20,000
		聖彼得堡市(St. Petersburg)	19,000
		其他城市	16,000
澳大利亞	國家	澳大利亞	21,000
紐西蘭	城市	奧克蘭市(Auckland)	21,000
		其他城市	20,000
日本	城市	東京都(Tokyo)	24,000
		京都府(Kyoto)	22,000
		大阪府(Osaka)、神戶市(Kobe)、名古屋市(Nagoya)、橫濱市(Yokohama)	20,000
		其他城市	19,000
印度	城市	孟買市(Mumbai)	20,000
		新德里市(New Delhi)	19,000
		其他城市	16,000
亞洲	城市	馬尼拉市(Manila)	19,000
		曼谷市(Bangkok)	18,000
		雅加達市(Jakarta)	17,000
		吉隆坡市(Kuala Lumpur)、金邊市(Phnom Pwnh)	16,000
		泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨之其他城市	15,000
	國家	新加坡	23,000
		越南、汶萊	17,000
		緬甸、寮國	15,000
上述以外之其他國家及城市			12,000

註：

1. 本標準係參考「中央各機關(含事業機構)派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」、「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」及「國家科學及技術委員會補助邀請國際科技人士短期訪問機票費補助金額表」修正，嗣後如有調整，則依新調整之公費標準支給。
2. 本部身心障礙公費留學生公費項目及支給數額標準之適用對象為依本部公費留學考試身心障礙考生注意事項報考且錄取者。
3. 身心障礙公費留學生年支生活費增給，係基於學習輔具及其他協助學習需求之考量，其年支生活費，係以公費標準表年支生活費為母數：

類別一	增給 25%	重度以上之視、聽障或重度多重障礙者
類別二	增給 15%	中度視、聽障、中度多重障礙或類別一以外其他障別重度以上者
類別三	增給 5%	除以上二類外之其他身心障礙者

身心障礙公費留學生之生活費支給認定係以報名時繳交身心障礙手冊(證明)所載永久性障礙為準。

4. 勵學優秀公費留學生及原住民公費留學生年支生活費比照身心障礙公費留學生年支生活費類別二標準支給。
5. 本公費撥款作業，悉依本部會計作業程序規定辦理。

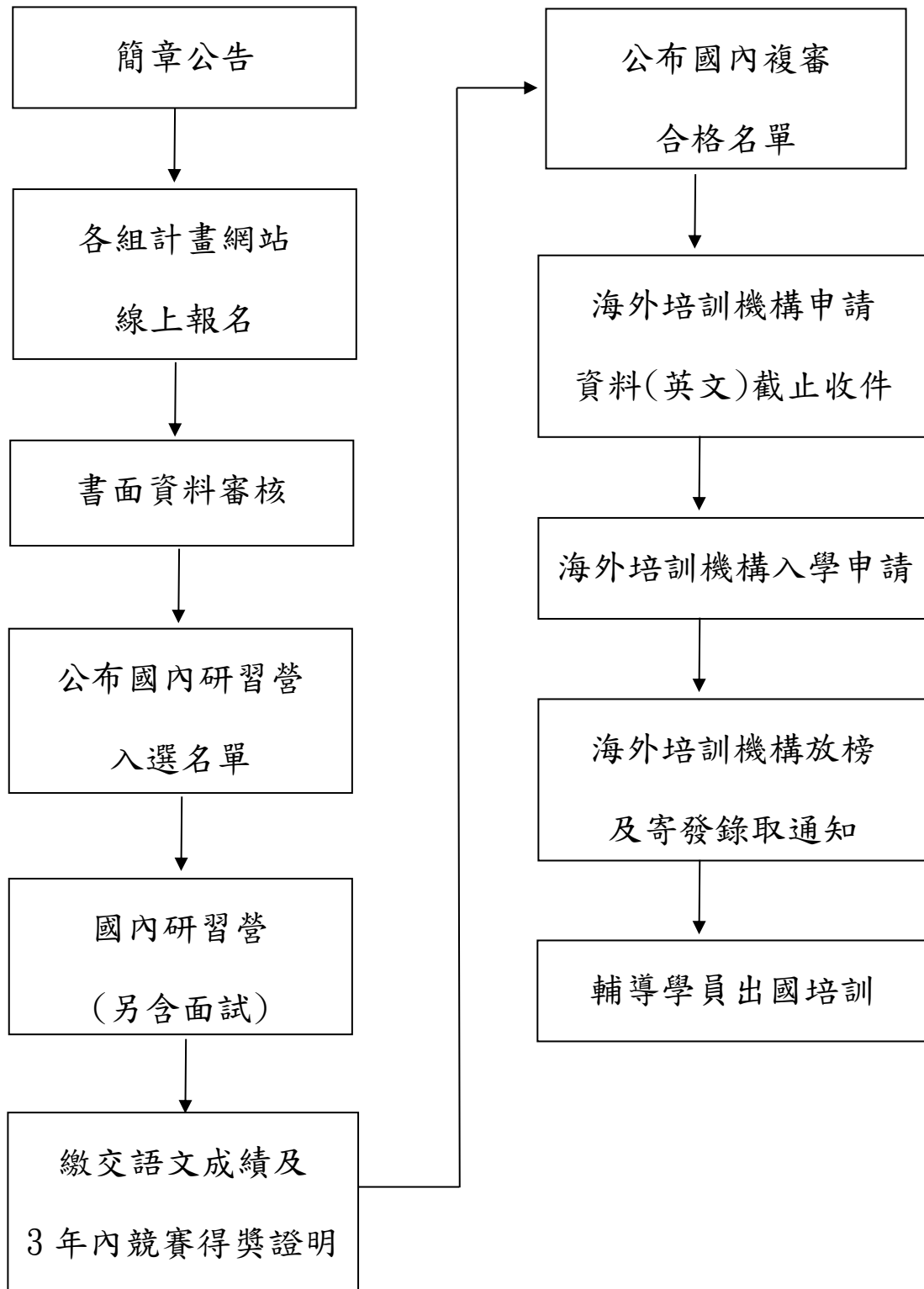
拾貳、錄取後注意事項：

- 一、錄取學員不得以任何理由申請保留錄取資格，另如發現報名資格不符規定，或所繳證件及資料有假借、冒用、偽造、變造等情事，取消其錄取資格。
- 二、錄取學員應自行注意其他補助計畫規定，如因計畫規則衝突而失資格應自負責任。
- 三、錄取學員於海外培訓期間，每月應定期撰寫一篇 500 字以上學習概況(包含圖片)，由承辦學校分享至本計畫網站及粉絲頁(臉書搜尋：藝術與設計菁英海外培訓計畫)。
- 四、錄取學員於一年培訓期滿回國後，需履行下列**推廣義務**：
 - (一) 成果發表會預演(由承辦學校指定地點)
 - (二) 教育部部內成果發表會
 - (三) 教育部記者會暨成果展
 1. 配合本活動準備工作，於指定時間(返國前)繳交各項個人文宣，例如：社群網站用推廣影片、展版設計圖文、展示作品模型或實體等。
 2. 依承辦學校規劃，於記者會後成果展期間進行成果導覽及主題座談會。
 3. 前項工作及圖文授權載於教育部與學員簽訂之「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」，遇有未盡事宜，若屬同類工作範疇，應配合承辦學校辦理。
 - (四) 另需於成果發表會後**三年內完成三項計畫推廣活動**，下列第一至第三項應擇二完成，第四項為必要履行項目：
 1. 製作一小時以上的學習心得線上教材(須經審查合格並有合法版權)。
 2. 參加暑期研習營一週(五個工作天)，擔任翻譯與心得分享工作。
 3. 擔任承辦學校規劃之設計工作坊講師一次。
 4. 出具國內或國外藝術與設計實務工作相關證明，依類別可區分為國內反饋實踐及國際產業鏈結。本項採累計點數制，所提證明經審核通過獲得下表頒布之點數，完成門檻為 5 點。本義務需完成至少兩項目，同項目可重複累計。

類別	項目	點數
國內實踐	任職產業1年以上，需提交在職證明(載明在任期間)及任職期間參與專案證明。	3
	以個人名義參與專案3件，需提交合約書與成果證明。	1
	擔任教育性質講師達12小時(不包含承辦學校規劃活動)，需提交授課單位開立之證明。	2
國際鏈結	引介國內外高等教育機構交流互訪，例如簽立合作備忘錄、國際工作營、國際研討會、學者演講等，需提交相關書信及訪問紀錄。	2
	促成國內外公司或機構合作案建立與進行，需提交相關書信及成案紀錄。	2
	參與國際設計相關組織職務或國際設計競賽評審工作，需提交相關聘書或證明。	1

五、若有其他情形或未盡事宜，悉依各組別甄選委員會決議辦理。

拾參、甄選流程圖：



數位動畫組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	9
二、甄選重要日程表	11
三、甄選各階段應繳審查資料	12
四、甄選方式等相關規定	14

一、『數位動畫組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 Savannah College of Arts and Design	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試成績 (佔總成績 10%) *參考備註 3	3 年內得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 85(各項不得低於 20); 或 IELTS 6.5(讀、寫不得低於 6.5)以上語言成績
美國 California Institute of the Arts	1				國外培訓機構規定資料與 大學部 TOEFL(iBT) 80; 或 IELTS 6.5 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 100; 或 IELTS 7 以上語言成績
加拿大 Sheridan College	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 88(各項不得低於 21); 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績
法國 RUBIKA Valenciennes	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 45 以上證明; 或 IELTS 4.0; 或 TCF 法 語檢定初級以上語言成績
法國 Gobelins Paris	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 45; 或 IELTS 4.0; 或 TCF 法語檢定初 級以上語言成績
荷蘭 Avans Professional Master	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 80; 或 IELTS 6.0 以上語言成績
澳洲 RMIT University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 79(各項最低標準: 讀 13、聽 12、說 18、寫 21); 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以 上語言成績
日本 Polygon Pictures Inc.	1				國外培訓機構規定資料與 JLPT2 級以上語言成績

備註	<p>1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。</p> <p>2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。</p> <p>3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。</p> <p>4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「數位動畫類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。3 年內得獎證明估計分比例 10%，無則免繳。另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。</p> <p>5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。</p> <p>6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>7、美國 Savannah、加拿大 Sheridan、法國 RUBIKA、法國 Gobelins、日本 Polygon 之培訓機構，須於初、複審中經審定 3D 技能合格者才予以分發。</p> <p>8、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。</p> <p>9、美國 CalArts 採交換學生制，複審合格者繳交申請文件後，由該校審核並決定適合就讀的年級。</p> <p>10、欲申請非英語系國家者，雖無硬性規定須繳交當地語言檢定，應理解仍需具當地語言基礎才能妥善學習與適應當地文化。</p> <p>11、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。</p>
----	--

二、『數位動畫組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	114年3月	
報名及繳件日期	即日起至114年5月28日(星期三)23:59:59止	於計畫網站之線上報名系統上傳各項資料，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營錄取通知	114年6月10日(星期二)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於114年6月16日(星期一)前	將培訓同意書以E-mail回報。
研習營備取生遞補	於114年6月18日(星期三)前	將培訓同意書以E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：114年7月3日(星期四)至7月11日(星期五)。 2. 地點：國立雲林科技大學。 3. 預計114年6月20日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	114年7月18日(星期五)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	114年12月3日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	115年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計115年6月12日(星期五)前	放榜，確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整。
正取生報到	115年6月22日(星期一)前	
備取缺額公告	115年6月24日(星期三)前	
備取生報到	115年6月26日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學生事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立雲林科技大學—教育部菁培計畫總辦公室承辦人(05)534-2601分機6593。

三、甄選各階段應繳審查資料

項	目說	明
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：請於計畫網站之線上報名系統填寫報名資料並上傳：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 二吋相片 (本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照) 2. 身分證影本 (正反面，資訊應清晰可辨) 3. 學籍證明(需為 113 年度在學證明或休學證明) 4. 下列各項資料。 <p>各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>學校推薦</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在學成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集(足以證明其創作潛力的數位動畫相關作品)。可就下列兩項擇一繳交： <ol style="list-style-type: none"> i) Demoreel(以 10 分鐘為限)及作品說明書。 ii) 動態腳本(animatic)闡述創作理念之半完成作品及作品說明書。 <p>※影片格式至少 HD720 解析度 mp4 或 mov，作品說明書格式 pdf。</p> <p>※團體作品請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。</p> <p>※運用 AI 協助設計、繪圖部分，請註明使用軟體及範疇。</p> (3) 學校推薦公文。 (4) 老師推薦函 (附件)。 (5) 語言能力證明影本(GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge、ESOL、日檢、韓檢、法檢、德檢等)，若無語言認證請檢附大學語言相關課程成績單。 (6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 2. <u>個人申請</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集(規範同學校推薦)。 (3) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 3. <u>獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集(規範同學校推薦)。 (2) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。 (3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 114 年 5 月 28 日(星期三) 23:59:59 止，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。</p>	

國內複審應繳資料	<p>於 114 年 12 月 3 日(星期三)前繳交以下文件，未繳交者，視同放棄：</p> <p>(一) 語言成績：欲申請之海外培訓機構規定之語言成績（請參考附錄一資訊及早應考，最新標準及效期請自行參考各培訓機構網站公告）。</p> <p>(二) 以下獎項獲獎記錄(3 年內)，得提交得獎證明加分： (1) 「臺灣國際學生創意設計大賽」之年度大獎、金獎、銀獎、銅獎、佳作。 (2) 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列之國際競賽（依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「數位動畫類」獎項）。</p> <p>(三) 志願表：標示欲申請學校之志願順序表。</p> <p>(四) 學籍證明： (1) 當學期之在學證明或休學證明。 (2) 大學應屆畢業生申請本組研究所者，須於複審資料收件截止日前提交國內研究所錄取證明。若錄取結果未公布，仍須於繳件截止日前繳交上述各項文件，並另簽署切結書，至遲於 114 年 12 月 10 日(星期三)前補交錄取證明，得併同繳交修正之志願表。</p>																
海外培訓機構決選應繳資料	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校統一繳交至海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="343 940 1444 1792"> <tr> <td data-bbox="343 940 646 1041">美國 Savannah College of Arts and Design</td> <td data-bbox="646 940 1444 1041">TOEFL(iBT)85 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 20；IELTS：讀、寫不得低於 6.5)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1041 646 1153">美國 California College of the Arts</td> <td data-bbox="646 1041 1444 1153">大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1153 646 1265">加拿大 Sheridan College</td> <td data-bbox="646 1153 1444 1265">TOEFL(iBT)88 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1265 646 1366">法國 RUBIKA Valenciennes</td> <td data-bbox="646 1265 1444 1366">TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1366 646 1467">法國 Gobelins Paris</td> <td data-bbox="646 1366 1444 1467">TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1467 646 1579">荷蘭 Avans Professional Master</td> <td data-bbox="646 1467 1444 1579">TOEFL(iBT)80 或 IELTS 6.0 以上證明。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1579 646 1680">澳洲 RMIT University</td> <td data-bbox="646 1579 1444 1680">TOELF(iBT)79 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOELF 各項最低：讀 13、聽 12、說 18、寫 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1680 646 1792">日本 Polygon Pictures Inc.</td> <td data-bbox="646 1680 1444 1792">JLPT 2 級以上證明。</td> </tr> </table>	美國 Savannah College of Arts and Design	TOEFL(iBT)85 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 20；IELTS：讀、寫不得低於 6.5)	美國 California College of the Arts	大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。	加拿大 Sheridan College	TOEFL(iBT)88 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)	法國 RUBIKA Valenciennes	TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。	法國 Gobelins Paris	TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。	荷蘭 Avans Professional Master	TOEFL(iBT)80 或 IELTS 6.0 以上證明。	澳洲 RMIT University	TOELF(iBT)79 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOELF 各項最低：讀 13、聽 12、說 18、寫 21；IELTS：各項不得低於 6.0)	日本 Polygon Pictures Inc.	JLPT 2 級以上證明。
美國 Savannah College of Arts and Design	TOEFL(iBT)85 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 20；IELTS：讀、寫不得低於 6.5)																
美國 California College of the Arts	大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。																
加拿大 Sheridan College	TOEFL(iBT)88 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)																
法國 RUBIKA Valenciennes	TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。																
法國 Gobelins Paris	TOEFL(iBT)45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。																
荷蘭 Avans Professional Master	TOEFL(iBT)80 或 IELTS 6.0 以上證明。																
澳洲 RMIT University	TOELF(iBT)79 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOELF 各項最低：讀 13、聽 12、說 18、寫 21；IELTS：各項不得低於 6.0)																
日本 Polygon Pictures Inc.	JLPT 2 級以上證明。																
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上述各項文件經查若有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。 2. 所繳交之文件及審查資料，由計畫辦公室留存備查，不予退還。 3. 學生應自行檢查所繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，一概不受理任何形式之補救要求。 																

四、甄選方式等相關規定

組別	數位動畫組							
甄選資格	113 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。							
培訓機構	美國 Savannah College of Arts and Design	美國 California Institute of the Arts	加拿大 Sheridan College	法國 RUBIKA Valenciennes	法國 Gobelins Paris	荷蘭 Avans Professional Master	澳洲 RMIT University	日本 Polygon Pictures Inc.
研究領域	角色動畫 動畫創作 美術設定 (研究所)	實驗動畫 動畫藝術 產業鏈結 (大學部、研究所)	動畫短片 電腦動畫 動畫技術 (研究所)	電影特效 動畫實務 動畫電影 (專業學程)	電影動畫 動畫特效 動畫實務 (專業學程)	動畫實習 動畫藝術 動畫應用 (研究所)	動畫理論 數位創作 產業實習 (研究所)	動畫實務 遊戲動畫 動畫電影 (產業實習)
招生名額	1	1	1	1	1	1	1	1
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多共 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構或海外專業領域之業界代表擔任。</p> <p>國內複審：</p> <p>一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「數位動畫類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。</p> <p>二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>三、美國 Savannah、加拿大 Sheridan、法國 RUBIKA、法國 Gobelins、日本 Polygon 之培訓機構，須於初、複審中經審定 3D 技能合格者才予以分發。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>							
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。</p> <p>複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>							
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由由申請資格保留。							
聯絡方式	E-mail: sposad@yuntech.edu.tw; 電話: (05)534-2601 分機 6593							
計畫目標	數位工具、媒體創意為新興文化創意產業與數位內容產業之核心，亦是目前國家發展計畫的重點產業。「數位動畫」領域結合科技、美學與文化，更是被看好的明星文化創意產業。近年來除了具有豐富製作經驗的美、日先進國家之外，其他開發中國家，也相繼投入可觀的國家資源推動本產業發展。							

視覺傳達設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	16
二、甄選重要日程表	18
三、甄選各階段應繳審查資料	19
四、甄選方式等相關規定	21

一、『視覺傳達設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 ArtCenter College of Design	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試成績 (佔總成績 10%) *參考備註 3	3 年內得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構資料審查與 大學部 TOEFL(iBT) 80；或 IELTS 6.5 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 100；或 IELTS 7.0 以上語言成績
美國 Pratt Institute	1				國外培訓機構規定資料與 大學部 TOEFL(iBT) 92；或 IELTS 6.5 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 85；或 IELTS 6.5 以上語言成績
法國 Gobelins Paris	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 45；或 IELTS 4.0 以上； 或 TCF 法語檢定初級以上語言成績
丹麥 Kolding School of Design	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 83(各項不得低於20)；或 IELTS 6.5 以上語 言成績
澳洲 Swinburne University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 60(各項最低標準：讀10、聽9、說16、 寫19)；或 IELTS 6.0(各項不得低於5.5)以上語言成 績
韓國 Hongik University	1				國外培訓機構規定資料與 韓檢 TOPIK 三級以上語言成績；或 TOEFL(iBT) 71；或 IELTS 5.5
日本 Musashino Art University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 61；或 IELTS 5.0 以上語言成績； 或 JLPT 三級以上語言成績

備註	<p>1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。</p> <p>2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。</p> <p>3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。</p> <p>4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「視覺傳達設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。3 年內得獎證明佔計分比例 10%，無則免繳。另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。</p> <p>5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。</p> <p>6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>7、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。</p> <p>8、欲申請非英語系國家者，雖無硬性規定須繳交當地語言檢定，應理解仍需具當地語言基礎才能妥善學習與適應當地文化。</p> <p>9、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。</p>
----	--

二、『視覺傳達設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	114年3月	
報名及繳件日期	即日起至114年5月28日(星期三)23:59:59止	於計畫網站之線上報名系統上傳各項資料，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營入選通知	114年6月10日(星期二)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於114年6月16日(星期一)前	將培訓同意書以E-mail回報。
研習營備取生遞補	於114年6月18日(星期三)前	將培訓同意書以E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：114年7月3日(星期四)至7月11日(星期五)。 2. 地點：國立雲林科技大學。 3. 預計114年6月20日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	114年7月18日(星期五)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	114年12月3日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	115年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計115年6月12日(星期五)前	放榜，確實時間以海外學校公布決選結果彈性調整。
正取生報到	115年6月22日(星期一)前	
備取缺額公告	115年6月24日(星期三)前	
備取生報到	115年6月26日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學生事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立雲林科技大學—教育部菁培計畫總辦公室承辦人(05)534-2601分機6593。

三、甄選各階段應繳審查資料

項	目說	明
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：請於計畫網站之線上報名系統填寫報名資料並上傳：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 二吋相片 (本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照) 2. 身分證影本 (正反面，資訊應清晰可辨) 3. 學籍證明(需為 113 年度在學證明或休學證明) 4. 下列各項資料。 <p>各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校推薦： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集(足以證明其創作潛力的視覺傳達設計相關作品)。作品至少五件以上，請詳述作品理念與發展過程、成果展示及說明，包含構想圖、完成作品或成品照片，請以電子檔方式繳交。大小不得超過 A3 格式，並製作封面，內附相關之圖片、相片。 ※團體作品請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。 ※運用 AI 協助設計、繪圖部分，請註明使用軟體及範疇。 (3) 學校推薦公文。 (4) 老師推薦函(附件)。 (5) 語言能力證明影本 (GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge、ESOL、日檢、韓檢、法檢、德檢等)，若無語言認證請檢附大學語言相關課程成績單。 (6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 2. 個人申請： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集(規範同學校推薦)。 (3) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 3. 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者： <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集 (規範同學校推薦)。 (2) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。 (3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本 (規範同學校推薦)。 <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 114 年 5 月 28 日(星期三) 23:59:59 止，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。</p>	

<p style="text-align: center;">國內複審應繳資料</p>	<p>於 114 年 12 月 3 日(星期三)前繳交以下文件，未繳交者，視同放棄：</p> <p>(一) 語言成績：欲申請之海外培訓機構規定之語言成績（請參考附錄一資訊及早應考，最新標準及效期請自行參考各培訓機構網站公告）。</p> <p>(二) 以下獎項獲獎記錄(3 年內)，得提交得獎證明加分：</p> <p>(1) 「臺灣國際學生創意設計大賽」之年度大獎、金獎、銀獎、銅獎、佳作。</p> <p>(2) 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列之國際競賽（依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「視覺傳達設計類」獎項）。</p> <p>(三) 志願表：標示欲申請學校之志願順序表。</p> <p>(四) 學籍證明：</p> <p>(1) 當學期之在學證明或休學證明。</p> <p>(2) 大學應屆畢業生申請本組研究所者，須於複審資料收件截止日前提交國內研究所錄取證明。若錄取結果未公布，仍須於繳件截止日前繳交上述各項文件，並另簽署切結書，至遲於 114 年 12 月 10 日(星期三)前補交錄取證明，得併同繳交修正之志願表。</p>														
<p style="text-align: center;">海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校統一繳交至海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="352 909 1428 1682"> <tr> <td data-bbox="352 909 651 1016"> <p style="text-align: center;">美國 ArtCenter College of Design</p> </td> <td data-bbox="657 909 1428 1016"> <p>大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1025 651 1122"> <p style="text-align: center;">美國 Pratt Institute</p> </td> <td data-bbox="657 1025 1428 1122"> <p>大學部：TOEFL(iBT) 92 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 85 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1131 651 1227"> <p style="text-align: center;">法國 Gobelins Paris</p> </td> <td data-bbox="657 1131 1428 1227"> <p>TOEFL(iBT) 45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1236 651 1332"> <p style="text-align: center;">丹麥 Kolding School of Design</p> </td> <td data-bbox="657 1236 1428 1332"> <p>TOEFL(iBT) 83(各項不得低於 20)；或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1341 651 1469"> <p style="text-align: center;">澳洲 Swinburne University of Technology</p> </td> <td data-bbox="657 1341 1428 1469"> <p>TOEFL(iBT) 60 或 IELTS 6.0 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀 10、聽 9、說 16、寫 19；IELTS 各項不得低於 5.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1478 651 1574"> <p style="text-align: center;">韓國 Hongik University</p> </td> <td data-bbox="657 1478 1428 1574"> <p>韓檢 TOPIK 三級以上語言成績；或 TOEFL(iBT) 71；或 IELTS 5.5</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1583 651 1682"> <p style="text-align: center;">日本 Musashino Art University</p> </td> <td data-bbox="657 1583 1428 1682"> <p>TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上或 JLPT 三級以上證明</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">美國 Pratt Institute</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 92 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 85 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">法國 Gobelins Paris</p>	<p>TOEFL(iBT) 45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">丹麥 Kolding School of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 83(各項不得低於 20)；或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">澳洲 Swinburne University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 60 或 IELTS 6.0 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀 10、聽 9、說 16、寫 19；IELTS 各項不得低於 5.5)</p>	<p style="text-align: center;">韓國 Hongik University</p>	<p>韓檢 TOPIK 三級以上語言成績；或 TOEFL(iBT) 71；或 IELTS 5.5</p>	<p style="text-align: center;">日本 Musashino Art University</p>	<p>TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上或 JLPT 三級以上證明</p>
<p style="text-align: center;">美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7 以上證明。</p>														
<p style="text-align: center;">美國 Pratt Institute</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 92 或 IELTS 6.5 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 85 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>														
<p style="text-align: center;">法國 Gobelins Paris</p>	<p>TOEFL(iBT) 45 或 IELTS 4.0 或 TCF 法語檢定初級以上證明。</p>														
<p style="text-align: center;">丹麥 Kolding School of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 83(各項不得低於 20)；或 IELTS 6.5 以上證明。</p>														
<p style="text-align: center;">澳洲 Swinburne University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 60 或 IELTS 6.0 以上證明。 (TOEFL 各項最低：讀 10、聽 9、說 16、寫 19；IELTS 各項不得低於 5.5)</p>														
<p style="text-align: center;">韓國 Hongik University</p>	<p>韓檢 TOPIK 三級以上語言成績；或 TOEFL(iBT) 71；或 IELTS 5.5</p>														
<p style="text-align: center;">日本 Musashino Art University</p>	<p>TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上或 JLPT 三級以上證明</p>														
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 上述各項文件經查若有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。 所繳交之文件及審查資料，由計畫辦公室留存備查，不予退還。 學生應自行檢查所繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，一概不受理任何形式之補救要求。 														

四、甄選方式等相關規定

組別	視覺傳達設計組						
甄選資格	113 學年度各公私立大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。						
培訓機構	美國 ArtCenter College of Design	美國 Pratt Institute	法國 Gobelins Paris	丹麥 Kolding School of Design	澳洲 Swinburne University of Technology	韓國 Hongik University	日本 Musashino Art University
研究領域	視覺傳達 設計實務 設計管理 (大學、研究所)	視覺傳達 包裝設計 設計實務 (大學、研究所)	動態設計 設計實務 傳達設計 (專業學程)	設計整合 創新實務 生活設計 (研究所)	視覺傳達 設計實務 媒體設計 (專業學程)	平面視覺 動態圖像 AI 應用 (專業學程)	傳達設計 構成創作 設計實務 (專業學程)
招生名額	1	1	1	1	1	1	1
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表或海外專業領域之業界代表擔任。</p> <p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「視覺傳達設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>						
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。</p> <p>複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>						
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。						
聯絡方式	E-mail：sposad@yuntech.edu.tw；電話：(05)534-2601 分機 6593						
計畫目標	「視覺傳達設計」在各類商業活動中扮演重要的角色，任何產品與廣告透過設計者的巧思與創意，經由適當且美觀的設計、包裝後，就能提升產品整體的價值與效益。此外，現今消費市場追求更精緻且時尚的品牌服務、產品包裝、廣告和形象設計，視覺傳達設計相關產業已列為多項重點發展範疇。因此，本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，以培育更多專業優秀人才。						

產品設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	23
二、甄選重要日程表	25
三、甄選各階段應繳審查資料	26
四、甄選方式等相關規定	28

一、『產品設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審(研習營)		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 ArtCenter College of Design	1	資料審查 (佔總成績 20%) * 參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試 (佔總成績 10%) * 參考備註 3	3 年內得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) * 參考備註 4	國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 80 ; 或 IELTS 6.5 以上語言成績
美國 College for Creative Studies	1				國外培訓機構規定資料與 大學部 TOEFL(iBT) 71 ; 或 IELTS 6.0 以上、 研究所 TOEFL(iBT) 80 ; 或 IELTS 6.5 以上語言成績
英國 Royal College of Art	1				國外培訓機構規定資料與 IELTS 6.5(寫作不得低於6.0, 其餘各項不得低於 5.5)以上語言成績
荷蘭 Delft University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TTOEFL(iBT) 100(各項不得低於22); 或 IELTS 7.0(各項不得低於6.5)以上語言成績
荷蘭 Eindhoven University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 90(各項不得低於21); 或 IELTS 6.5(各項不得低於6.0)以上語言成績
德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin	1				國外培訓機構規定資料與 德文檢定 A1 級; 或 TOEFL(iBT) 61 ; 或 IELTS 5.0 以上語言成績
澳洲 RMIT University	1				國外學校資料審查與 TOEFL(iBT) 79(各項最低標 準: 讀 13、聽 12、說 18、寫 21); 或 IELTS 6.5(各項不得低於6.0)以上語言成績
日本 Musashino Art University	1				國外培訓機構規定資料與 JLPT 2 級; 或 JLPT 3 級及 TOEFL iBT 61 或 IELTS 5.0 以上語言成績
日本 Chiba University	1				國外培訓機構規定資料與 150 小時以上日文修課證明; 或 TOEFL(iBT) 61 ; 或 IELTS 5.0 以上語言成績

備註	<p>1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。</p> <p>2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。</p> <p>3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。</p> <p>4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「產品設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。3 年內得獎證明佔計分比例 10%，無則免繳。另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 114 年 12 月 3 日 (星期三) 前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。</p> <p>5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。</p> <p>6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>7、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。</p> <p>8、英國 RCA、荷蘭 TUD、荷蘭 TU/e 為研究所課程，欲就讀該校學生須於海外研習期間具備國內研究所之學生身分。</p> <p>9、美國 ArtCenter、德國 Weißensee、日本 Musashino 為學士課程，僅限大學部學生選填；澳洲 RMIT 榮譽學士課程、美國 CCS、日本 Chiba 大學部及研究所學生皆可選填。</p> <p>10、欲申請非英語系國家者，雖無硬性規定須繳交當地語言檢定，應理解仍需具當地語言基礎才能妥善學習與適應當地文化。</p> <p>11、前往英國 RCA 進修者，申請英國學生簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。</p> <p>12、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。</p>
----	---

二、『產品設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	114年3月	
報名及繳件日期	即日起至114年5月28日(星期三)23:59:59止	於計畫網站之線上報名系統上傳各項資料，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營入選通知	114年6月10日(星期二)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於114年6月16日(星期一)前	將培訓同意書以E-mail回報。
研習營備取生遞補	於114年6月18日(星期三)前	將培訓同意書以E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：114年7月13日(星期日)至7月22日(星期二)。 2. 地點：國立成功大學。 3. 預計114年7月4日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	114年7月29日(星期二)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	114年12月3日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	115年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計115年6月12日(星期五)前	放榜，確實時間以海外學校公布決選結果彈性調整。
正取生報到	115年6月22日(星期一)前	
備取缺額公告	115年6月24日(星期三)前	
備取生報到	115年6月26日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學員事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或洽詢國立成功大學「工業設計系」教育部菁培計畫辦公室承辦人(06)275-7575分機54343。

三、甄選各階段應繳審查資料

項	目說	明
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：請於計畫網站之線上報名系統填寫報名資料並上傳：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 二吋相片 (本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照) 2. 身分證影本 (正反面，資訊應清晰可辨) 3. 學籍證明(需為 113 年度在學證明或休學證明) 4. 下列各項資料。 <p>各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>學校推薦</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集 (足以證明其創作潛力的產品設計相關作品)。 <ul style="list-style-type: none"> ※團體作品請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。 ※運用 AI 協助設計、繪圖部分，請註明使用軟體及範疇。 (3) 學校推薦公文。 (4) 老師推薦函 (附件)。 (5) 語言能力證明影本(GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge、ESOL、日檢、韓檢、法檢、德檢等)，若無語言認證請檢附大學語言相關課程成績單。 (6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 2. <u>個人申請</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集 (規範同學校推薦)。 (3) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本 (規範同學校推薦)。 3. <u>獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集 (規範同學校推薦) (2) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦) (3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本 (規範同學校推薦) <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 114 年 5 月 28 日(星期三) 23:59:59 止，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。</p>	

<p style="text-align: center;">國內複審應繳資料</p>	<p>於 114 年 12 月 3 日(星期三)前繳交以下文件，未繳交者，視同放棄：</p> <p>(一) 語言成績：欲申請之海外培訓機構規定之語言成績（請參考附錄一資訊及早應考，最新標準及效期請自行參考各培訓機構網站公告）。</p> <p>(二) 以下獎項獲獎記錄(3 年內)，得提交得獎證明加分：</p> <p>(1) 「臺灣國際學生創意設計大賽」之年度大獎、金獎、銀獎、銅獎、佳作。</p> <p>(2) 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列之國際競賽（依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「產品設計類」獎項）。</p> <p>(三) 志願表：標示欲申請學校之志願順序表。</p> <p>(四) 學籍證明：</p> <p>(1) 當學期之在學證明或休學證明。</p> <p>(2) 大學應屆畢業生申請本組研究所者，須於複審資料收件截止日前提交國內研究所錄取證明。若錄取結果未公布，仍須於繳件截止日前繳交上述各項文件，並另簽署切結書，至遲於 114 年 12 月 10 日(星期三)前補交錄取證明，得併同繳交修正之志願表。</p>																		
<p style="text-align: center;">海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校統一繳交至海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="375 929 1428 1814"> <tr> <td data-bbox="375 929 694 1041"> <p style="text-align: center;">美國 ArtCenter College of Design</p> </td> <td data-bbox="694 929 1428 1041"> <p>TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1041 694 1131"> <p style="text-align: center;">美國 College for Creative Studies</p> </td> <td data-bbox="694 1041 1428 1131"> <p>大學部：TOEFL(iBT) 71 或 IELTS 6.0 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1131 694 1220"> <p style="text-align: center;">英國 Royal College of Art</p> </td> <td data-bbox="694 1131 1428 1220"> <p>IELTS 6.5 以上證明。 (寫作不得低於 6.0，其餘各項不得低於 5.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1220 694 1332"> <p style="text-align: center;">荷蘭 Delft University of Technology</p> </td> <td data-bbox="694 1220 1428 1332"> <p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1332 694 1422"> <p style="text-align: center;">荷蘭 Eindhoven University of Technology</p> </td> <td data-bbox="694 1332 1428 1422"> <p>TOEFL(iBT) 90 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1422 694 1512"> <p style="text-align: center;">德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin</p> </td> <td data-bbox="694 1422 1428 1512"> <p>德文檢定 A1 級 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1512 694 1624"> <p style="text-align: center;">澳洲 RMIT University</p> </td> <td data-bbox="694 1512 1428 1624"> <p>TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)； 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1624 694 1713"> <p style="text-align: center;">日本 Musashino Art University</p> </td> <td data-bbox="694 1624 1428 1713"> <p>JLPT2 級；或 JLPT3 級及 TOEFL(iBT)61 或 IELTS5.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1713 694 1814"> <p style="text-align: center;">日本 Chiba University</p> </td> <td data-bbox="694 1713 1428 1814"> <p>150 小時以上日文修課證明 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">美國 College for Creative Studies</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 71 或 IELTS 6.0 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">英國 Royal College of Art</p>	<p>IELTS 6.5 以上證明。 (寫作不得低於 6.0，其餘各項不得低於 5.5)</p>	<p style="text-align: center;">荷蘭 Delft University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p>	<p style="text-align: center;">荷蘭 Eindhoven University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 90 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</p>	<p style="text-align: center;">德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin</p>	<p>德文檢定 A1 級 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">澳洲 RMIT University</p>	<p>TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)； 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績。</p>	<p style="text-align: center;">日本 Musashino Art University</p>	<p>JLPT2 級；或 JLPT3 級及 TOEFL(iBT)61 或 IELTS5.0 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">日本 Chiba University</p>	<p>150 小時以上日文修課證明 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>
<p style="text-align: center;">美國 ArtCenter College of Design</p>	<p>TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>																		
<p style="text-align: center;">美國 College for Creative Studies</p>	<p>大學部：TOEFL(iBT) 71 或 IELTS 6.0 以上證明； 研究所：TOEFL(iBT) 80 或 IELTS 6.5 以上證明。</p>																		
<p style="text-align: center;">英國 Royal College of Art</p>	<p>IELTS 6.5 以上證明。 (寫作不得低於 6.0，其餘各項不得低於 5.5)</p>																		
<p style="text-align: center;">荷蘭 Delft University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p>																		
<p style="text-align: center;">荷蘭 Eindhoven University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 90 或 IELTS 6.5 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 21；IELTS：各項不得低於 6.0)</p>																		
<p style="text-align: center;">德國 Weißensee Kunsthochschule Berlin</p>	<p>德文檢定 A1 級 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>																		
<p style="text-align: center;">澳洲 RMIT University</p>	<p>TOEFL(iBT) 79(各項最低標準：讀 13、聽 12、說 18、寫 21)； 或 IELTS 6.5(各項不得低於 6.0)以上語言成績。</p>																		
<p style="text-align: center;">日本 Musashino Art University</p>	<p>JLPT2 級；或 JLPT3 級及 TOEFL(iBT)61 或 IELTS5.0 以上證明。</p>																		
<p style="text-align: center;">日本 Chiba University</p>	<p>150 小時以上日文修課證明 或 TOEFL(iBT) 61 或 IELTS 5.0 以上證明。</p>																		
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上述各項文件經查若有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。 2. 所繳交之文件及審查資料，由計畫辦公室留存備查，不予退還。 3. 學生應自行檢查所繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，一概不受理任何形式之補救要求。 																		

四、甄選方式等相關規定

組別	產品設計組									
甄選資格	113學年度各大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。									
培訓機構	美國 ArtCenter College of Design	美國 College for Creative Studies	英國 Royal College of Art	荷蘭 Delft University of Technology	荷蘭 Eindhoven University of Technology	德國 Weiβensee Kunsthochschule Berlin	澳洲 RMIT University	日本 Musashino Art University	日本 Chiba University	
研究領域	產品設計 (大學)	產品設計 體驗設計 (大學或 研究所)	產品設計 (研究所)	整合設計 策略設計 互動設計 (研究所)	工業設計 (研究所)	產品設計 (大學)	工業設計 (榮譽學士)	工藝設計 工業設計 (大學)	產品設計 工業設計 (大學或 研究所)	
招生名額	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」成績 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表或海外專業領域之業界代表擔任。</p>									
	<p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「產品設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p>									
	<p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>									
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。 複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>									
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。									
聯絡方式	E-mail: idencku@gmail.com; 電話: (06) 275-7575 分機 54343									
計畫目標	本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，藉由海外培訓培養具國際性前瞻視野之學生，養成具備融合中外設計理念、擴展創新創意之設計才能，培育更多專業優秀人才。									

建築與景觀設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	30
二、甄選重要日程表	32
三、甄選各階段應繳審查資料	33
四、甄選方式等相關規定	35

一、『建築與景觀設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審(研習營)		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 Syracuse University	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試 (佔總成績 10%) *參考備註 3	3 年內得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之語 言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構規定資料 研究所 TOEFL(iBT) 90 ; 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上語言成績
美國 Parsons the New School of Design	1				國外培訓機構規定資料與 研究所 TOEFL(iBT) 92 ; 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上語言成績
英國 University College London	1				國外培訓機構規定資料與 研究所 TOEFL(iBT) 92(各項最低標準:讀/寫 24 以上、 聽/說 20 以上);或 IELTS Overall Band Score 6.5(各項 成績 6.0)以上語言成績
英國 Cook Haffner Architecture Platform	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT) 75 ; 或 IELTS UKVI Overall Band Score 6.0 以上語言成 績
荷蘭 Delft University of Technology	1				國外培訓機構規定資料與 TTOEFL(iBT) 100(各項不得低於 22); 或 IELTS 7.0(各項不得低於 6.5)以上語言成績
法國 School of Architecture Parsis-Est	1				國外培訓機構規定資料與 法文檢定 DELF-B1;或 TOEFL(iBT) 61 以上語言成績及 150 小時以上法文修課證明
日本 Tohoku University	1				國外培訓機構規定資料與 JLPT 2 級及 TOEFL(iBT) 79 ;或 IELTS 6.0 以上語言成績

備註	<p>1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他助審查之證明文件與資料 30%。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。</p> <p>2、初審第二階段研習營之錄取名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：錄取 30 名，備取 10 名。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。</p> <p>3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。</p> <p>4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「建築與景觀設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。3 年內得獎證明佔計分比例 10%，無則免繳。另語言成績為審查門檻不另計分。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。</p> <p>5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。</p> <p>6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>7、美國 SU、英國 UCL、荷蘭 Delft 為研究所學程，法國 Paris-Est 為研究生交換學程，欲就讀前列學校學生須於海外研習期間具備國內研究所之學生身分。</p> <p>8、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。</p> <p>9、欲申請非英語系國家者，雖無硬性規定須繳交當地語言檢定，應理解仍需具當地語言基礎才能妥善學習與適應當地文化。</p> <p>10、前往英國單位研習者，申請英國簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。</p> <p>11、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。</p>
----	--

二、『建築與景觀設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	114年3月	
報名及繳件日期	即日起至114年5月28日(星期三)23:59:59止	於計畫網站之線上報名系統上傳各項資料，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營錄取通知	114年6月10日(星期二)前	(依實際公告日為主)以 E-mail 通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	114年6月16日(星期一)前	將培訓同意書以 E-mail 回報。
研習營備取生遞補	114年6月18日(星期三)前	將培訓同意書以 E-mail 回報。
國內研習營	1. 時間：114年7月13日(星期日)至7月22日(星期二)。 2. 地點：國立成功大學。 3. 預計114年7月4日(星期五)前公告研習營報到須知於計畫網站，並 E-mail 通知，另由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。	
公布研習營排	114年7月29日(星期二)	以 E-mail 寄發，並公告於計畫網站。 ※如因成績回收更新期程，實際日期以承辦學校公告為準。
複審資料繳件日期	114年12月3日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	115年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計115年6月12日(星期五)前	放榜，確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整。
正取生報到	115年6月22日(星期一)前	
備取缺額公告	115年6月24日(星期三)前	
備取生報到	115年6月26日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學員事項，主要採 E-mail 通知及網站公告
(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學員請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立成功大學「建築學系」教育部菁培計畫承辦人
(06) 275-7575 分機 50238。

三、甄選各階段應繳審查資料

項	目說	明
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：請於計畫網站之線上報名系統填寫報名資料並上傳：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 二吋相片 (本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照) 2. 身分證影本 (正反面，資訊應清晰可辨) 3. 學籍證明(需為 113 年度在學證明或休學證明) 4. 下列各項資料。 各項資料送出前請確認完整無誤。 <p>(二) 初審第一階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>學校推薦</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集 (足以證明其創作潛力的建築與景觀設計相關專案或作品)。 ※團體作品請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。 ※運用 AI 協助設計、繪圖部分，請註明使用軟體及範疇。 (3) 學校推薦公文。 (4) 老師推薦函 (附件)。 (5) 語言能力證明影本 (GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge、ESOL、日檢、韓檢、法檢、德檢等)，若無語言認證請檢附大學語言相關課程成績單。 (6) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 2. <u>個人申請</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集 (規範同學校推薦)。 (3) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本 (規範同學校推薦)。 3. <u>獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者</u>： <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集 (規範同學校推薦)。 (2) 語言能力證明影本 (規範同學校推薦)。 (3) 其他有助於審查之證明文件與資料影本 (規範同學校推薦)。 <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 114 年 5 月 28 日(星期三) 23:59:59 止，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。</p>	

<p style="text-align: center;">國內複審應繳資料</p>	<p>於 114 年 12 月 3 日(星期三)前繳交以下文件，未繳交者，視同放棄：</p> <p>(一) 語言成績：欲申請之海外培訓機構規定之語言成績（請參考附錄一資訊及早應考，最新標準及效期請自行參考各培訓機構網站公告）。</p> <p>(二) 以下獎項獲獎記錄(3 年內)，得提交得獎證明加分：</p> <p>(1) 「臺灣國際學生創意設計大賽」之年度大獎、金獎、銀獎、銅獎、佳作。</p> <p>(2) 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列之國際競賽（依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「建築與景觀設計類」獎項）。</p> <p>(三) 志願表：標示欲申請學校之志願順序表。</p> <p>(四) 學籍證明：</p> <p>(1) 當學期之在學證明或休學證明。</p> <p>(2) 大學應屆畢業生申請本組研究所者，須於複審資料收件截止日前提交國內研究所錄取證明。若錄取結果未公布，仍須於繳件截止日前繳交上述各項文件，並另簽署切結書，至遲於 114 年 12 月 10 日(星期三)前補交錄取證明，得併同繳交修正之志願表。</p>														
<p style="text-align: center;">海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫、推薦函及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校統一繳交至海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="373 936 1433 1626"> <tr> <td data-bbox="373 936 683 1032"> <p>美國 Syracuse University</p> </td> <td data-bbox="683 936 1433 1032"> <p>TOEFL(iBT)90 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1032 683 1128"> <p>美國 Parsons the New School of Design</p> </td> <td data-bbox="683 1032 1433 1128"> <p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Core 7.0 以上語言成績</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1128 683 1225"> <p>英國 University College London</p> </td> <td data-bbox="683 1128 1433 1225"> <p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上證明。 (TOEFL：讀/寫 24 以上、聽/說 20 以上；IELTS：各項成績 6.0 以上)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1225 683 1321"> <p>英國 Cook Haffner Architecture Platform</p> </td> <td data-bbox="683 1225 1433 1321"> <p>TOEFL(iBT)75 或 IELTS UKVI Overall Band Score 6.0 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1321 683 1417"> <p>荷蘭 Delft University of Technology</p> </td> <td data-bbox="683 1321 1433 1417"> <p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1417 683 1514"> <p>法國 School of Architecture Paris-Est</p> </td> <td data-bbox="683 1417 1433 1514"> <p>法文檢定 DELF-B1； 或 TOEFL(iBT)61 以上證明及 150 小時以上法文修課證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1514 683 1626"> <p>日本 Tohoku University</p> </td> <td data-bbox="683 1514 1433 1626"> <p>JLPT2 級及 TOEFL(iBT)79 或 IELTS 6.0 以上證明。</p> </td> </tr> </table>	<p>美國 Syracuse University</p>	<p>TOEFL(iBT)90 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上證明。</p>	<p>美國 Parsons the New School of Design</p>	<p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Core 7.0 以上語言成績</p>	<p>英國 University College London</p>	<p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上證明。 (TOEFL：讀/寫 24 以上、聽/說 20 以上；IELTS：各項成績 6.0 以上)</p>	<p>英國 Cook Haffner Architecture Platform</p>	<p>TOEFL(iBT)75 或 IELTS UKVI Overall Band Score 6.0 以上證明。</p>	<p>荷蘭 Delft University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p>	<p>法國 School of Architecture Paris-Est</p>	<p>法文檢定 DELF-B1； 或 TOEFL(iBT)61 以上證明及 150 小時以上法文修課證明。</p>	<p>日本 Tohoku University</p>	<p>JLPT2 級及 TOEFL(iBT)79 或 IELTS 6.0 以上證明。</p>
<p>美國 Syracuse University</p>	<p>TOEFL(iBT)90 或 IELTS Overall Band Score 7.0 以上證明。</p>														
<p>美國 Parsons the New School of Design</p>	<p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Core 7.0 以上語言成績</p>														
<p>英國 University College London</p>	<p>TOEFL(iBT)92 或 IELTS Overall Band Score 6.5 以上證明。 (TOEFL：讀/寫 24 以上、聽/說 20 以上；IELTS：各項成績 6.0 以上)</p>														
<p>英國 Cook Haffner Architecture Platform</p>	<p>TOEFL(iBT)75 或 IELTS UKVI Overall Band Score 6.0 以上證明。</p>														
<p>荷蘭 Delft University of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 100 或 IELTS 7.0 以上證明。 (TOEFL：各項不得低於 22；IELTS：各項不得低於 6.5)</p>														
<p>法國 School of Architecture Paris-Est</p>	<p>法文檢定 DELF-B1； 或 TOEFL(iBT)61 以上證明及 150 小時以上法文修課證明。</p>														
<p>日本 Tohoku University</p>	<p>JLPT2 級及 TOEFL(iBT)79 或 IELTS 6.0 以上證明。</p>														
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 上述各項文件經查若有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。 所繳交之文件及審查資料，由計畫辦公室留存備查，不予退還。 學生應自行檢查所繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，一概不受理任何形式之補救要求。 														

四、甄選方式等相關規定

組別	建築與景觀設計組						
甄選資格	113 學年度各公立私立大學校院大學部二年級以上或研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。						
培訓機構	美國 Syracuse University	美國 Parsons the New School of Design	英國 University College London	英國 Cook Haffner Architecture Platform	荷蘭 Delft University of Technology	法國 School of Architecture Paris-Est	日本 Tohoku University
研究領域	建築設計 建成環境 (研究所)	建築設計 (大學或研究所)	生技整合建築 設計 (研究所)	建築設計、 景觀環境設計 (產業實習)	建築設計、都 市設計、景觀 建築、環境管 理、建築科技 (研究所)	建築設計 (碩士交換學程)	都市建築設計、 都市建築規劃、 永續建築科技、 建築構造工學 (大學)
招生名額	1	1	1	1	1	1	1
申請方式	<p>初審第一階段「國內研習營申請」審查及第二階段「國內研習營」成績 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多 33 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表或海外專業領域之業界代表擔任。</p> <p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「建築與景觀設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>						
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。</p> <p>複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>						
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。						
聯絡方式	E-mail : sposad.ald@gmail.com ; 電話 : (06) 275-7575 分機 50238						
計畫目標	本計畫規劃以本領域海外知名學校及機構為合作對象，藉由海外培訓培養具國際性及前瞻視野學生，並透過中外設計理念之融合，孕育多元文化與科技創意、建築與景觀設計之跨域藝術人才。						

時尚設計組

項目	頁數
一、培訓機構一覽表	37
二、甄選重要日程表	38
三、甄選各階段應繳審查資料	39
四、甄選方式等相關規定	41

一、『時尚設計組』培訓機構一覽表

機構	錄取名額	初審(研習營)		國內複審	海外培訓機構決選
		第一階段 國內研習營申請	第二階段 國內研習營		
美國 Fashion Institute of Technology	1	資料審查 (佔總成績 20%) *參考備註 1	研習營成績 (佔總成績 60%) 面試成績 (佔總成績 10%) *參考備註 3	3 年內得獎證明 (佔總成績 10%) 海外各機構要求之 語言成績證明 (不另計分) *參考備註 4	國外培訓機構規定資料 TOEFL(iBT) 80；或 IELTS 6.5 以上語言成績
英國 London College of Fashion	1				國外培訓機構規定資料與 IELTS 6.5 以上語言成績 (各項不得低於 6)
韓國 Ewha Womans University	1				國外培訓機構規定資料與 TOEFL(iBT)80；或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三 級以上語言成績
<p>1、國內初審分兩階段，第一階段「國內研習營申請」繳交文件與審查之各項計分比例為：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：作品集 50%、語言能力證明 20%、其他有助審查之證明文件與資料 30%。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：作品集、語言能力證明、其他有助審查之證明文件與資料。</p> <p>2、初審第二階段研習營錄取之名單依第一階段「國內研習營申請」審查成績辦理：</p> <p>(1)學校推薦、個人申請：錄取 20 名，備取 6 名。</p> <p>(2)獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者：至多錄取 3 名。</p> <p>3、國內研習營除外師之術科評分外，並設有研習營規定，違反規定者扣分，併入計算總分。另於研習營期間擇日安排面試。</p> <p>4、國內複審：繳交各培訓機構要求門檻之語言成績證明、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「時尚設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。3 年內得獎證明估計分比例 10%，無則免繳。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期或未繳件概不受理，視同放棄。</p> <p>備註 5、語言成績除海外培訓機構在複審會議日期前公告受理 TOEFL My Best Scores 外，則一律不採用。</p> <p>6、國內複審成績：以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據；並參考學員志願表挑選各培訓機構錄取名額最多 4 倍之合格名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>7、美國 FIT 為 2 年制碩士學程，欲申請該校者，請確定第二年會自費就讀至取得學位，再以該校為申請志願學校。</p> <p>8、複審合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料及海外培訓機構要求之語文能力證明參加決選。繳交日期依海外培訓機構期程另行公告調整之。</p> <p>9、欲申請非英語系國家者，雖無硬性規定須繳交當地語言檢定，應理解仍需具當地語言基礎才能妥善學習與適應當地文化。</p> <p>10、前往英國 LCF 進修者，申請英國學生簽證時需提出於 SELT(Secure English Language Testing)機構進行之英文考試成績如 IELTS UKVI。</p> <p>11、當外交部公告海外培訓機構所處地區為旅遊紅色警戒區時，教育部得不選送學員至該機構進修，雖有缺額亦不錄取。</p>					

二、『時尚設計組』甄選重要日程表

作業事項	日期	說明
簡章公告	114年3月	
報名及繳件日期	即日起至114年5月28日(星期三)止	於計畫網站之線上報名系統上傳報名表及指定資料，系統於當日23:59:59自動截止關閉，逾時恕不受理。
公布初審第一階段合格名單與研習營錄取通知	114年6月10日(星期二)	(依實際公告日為主)。 以E-mail通知第一階段「國內研習營申請」審查結果與研習營相關通知。
研習營正取生報到	於114年6月16日(星期一)前	將培訓同意書以E-mail回報。
研習營備取生遞補	於114年6月18日(星期三)前	將培訓同意書以E-mail回報。
國內研習營	1. 時間：114年6月30日(星期一)至7月10日(星期四)。 2. 地點：台南應用科技大學。 3. 預計114年6月20日(星期五)前	公告課表於計畫網站，並由承辦學校協助研習學員報到與住宿安排。
公布研習營排	114年7月17日(星期四)	以E-mail寄發，並公告於計畫網站。
複審資料繳件日期	114年12月3日(星期三)前	※倘海外培訓機構更新期程，承辦學校將另行公告調整。
海外培訓機構申請資料繳交日期		於複審會議結果公告後，另行公告海外培訓機構申請截止日期。
海外培訓機構審核	115年1月至5月	
放榜及寄發正備取通知	預計115年6月12日(星期五)前	放榜，確實時間以海外培訓機構公布決選結果彈性調整。
正取生報到	115年6月22日(星期一)前	
備取缺額公告	115年6月24日(星期三)前	
備取生報到	115年6月26日(星期五)前	

注意事項：

1. 本次甄選各項通知學生事項，均採E-mail通知及網站公告(網址：<https://www.animlab.yuntech.edu.tw/sposad/>)，必要時輔以掛號郵件郵寄。
2. 報名學生請注意「甄選重要日程表」各項作業時間；若於排定日程未接獲通知(E-mail)，請自行上網查詢或電話洽詢國立雲林科技大學—教育部菁培計畫總辦公室承辦人(05)534-2601分機6593。

三、甄選各階段應繳審查資料

項	目 說	明
國內初審第一階段應繳資料	<p>(一) 報名：請於計畫網站之線上報名系統填寫報名資料並上傳：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 二吋相片 (本人最近三個月內，二吋半身脫帽正面照) 2. 身分證影本 (正反面，資訊應清晰可辨) 3. 學籍證明(需為 113 年度在學證明或休學證明) 4. 下列各項資料。 <p>各項資料送出前請確認完整無誤。</p> <p>(二) 初審第一階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校推薦： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單，紙本成績單請以掃描方式提供，勿提供翻拍照片。 (2) 作品集：作品至少 5 件以上，詳述作品理念與發展過程、成果展示及說明，包含構想圖(以照片及文字呈現深入研究、設計發展過程、材質與實驗)、完成作品及成品照片，製作封面且大小不得超過 A3 格式。 ※團體作品請註明個人於該作品之貢獻及組員人數、姓名。 ※運用 AI 協助設計、繪圖部分，請註明使用軟體及範疇。 (3) 介紹影片：自錄至長 5 分鐘的介紹影片，介紹所提作品集內之作品一件，除作品特寫鏡頭外，本人及作品需同時入鏡，可剪接無需一鏡到底。介紹過程中，請包含至少 15 秒的 360 度視角拍攝作品全貌。自述內容應有服裝版型、用料材質、手法技術、細節及特有的重點，可於畫面上打上文字輔助提示。影片格式：至少 HD720 解析度，mp4 或 mov 格式。 (4) 學校推薦公文。 (5) 老師推薦函(附件)。 (6) 語言能力證明影本(GEPT、TOEIC、TOEFL、IELTS、CSEPT、Cambridge、ESOL、日檢、韓檢、法檢、德檢等)，若無語言認證請檢附大學語言相關課程成績單。 (7) 其他有助於審查之證明文件與資料影本，將各類檔案彙整成一份檔案上傳。例如：品牌行銷企劃、特殊專長等證明、曾發表之作品、證照、獲獎紀錄等。 2. 個人申請： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大學(含)以上在校成績單。 (2) 作品集(規範同學校推薦)。 (3) 介紹影片(規範同學校推薦)。 (4) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。 (5) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 3. 獲金點新秀設計獎年度最佳設計獎者： <ol style="list-style-type: none"> (1) 作品集(規範同學校推薦)。 (2) 介紹影片(規範同學校推薦)。 (3) 語言能力證明影本(規範同學校推薦)。 (4) 其他有助於審查之證明文件與資料影本(規範同學校推薦)。 <p>(三) 初審資料繳交期限： 至 114 年 5 月 28 日(星期三) 23:59:59 止，系統自動截止關閉，逾時恕不受理。</p>	

<p style="text-align: center;">國內複審應繳資料</p>	<p>於114年12月3日(星期三)前繳交以下文件，未繳交者，視同放棄：</p> <p>(一) 語言成績：欲申請之海外培訓機構規定之語言成績(請參考附錄一資訊及早應考，最新標準及效期請自行參考各培訓機構網站公告)。</p> <p>(二) 以下獎項獲獎記錄(3年內)，得提交得獎證明加分：</p> <p>(1) 「臺灣國際學生創意設計大賽」之年度大獎、金獎、銀獎、銅獎、佳作。</p> <p>(2) 「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「時尚設計類」獎項)。</p> <p>(三) 志願表：標示欲申請學校之志願順序表。</p> <p>(四) 學籍證明：</p> <p>(1) 當學期之在學證明或休學證明。</p> <p>(2) 大學應屆畢業生申請本組研究所者，須於複審資料收件截止日前提交國內研究所錄取證明。若錄取結果未公布，仍須於繳件截止日前繳交上述各項文件，並另簽署切結書，至遲於114年12月10日(星期三)前補交錄取證明，得併同繳交修正之志願表。</p>						
<p style="text-align: center;">海外培訓機構決選應繳資料</p>	<p>國內複審合格者須檢送英文作品集、英文研習計畫及相關英譯表件資料等，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本。由本組承辦學校統一繳交至海外培訓機構進行決選，繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，承辦學校於國內複審結果公告後另行公告。</p> <table border="1" data-bbox="336 920 1428 1346"> <tr> <td data-bbox="336 920 571 1066"> <p style="text-align: center;">美國 Fashion Institute of Technology</p> </td> <td data-bbox="571 920 1428 1066"> <p>TOEFL(iBT) 80；或 IELTS 6.5 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1066 571 1205"> <p style="text-align: center;">英國 London College of Fashion</p> </td> <td data-bbox="571 1066 1428 1205"> <p>IELTS 6.5 (各項不得低於6) 以上證明。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1205 571 1346"> <p style="text-align: center;">韓國 Ewha Womans University</p> </td> <td data-bbox="571 1205 1428 1346"> <p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三級以上證明。</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">美國 Fashion Institute of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 80；或 IELTS 6.5 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">英國 London College of Fashion</p>	<p>IELTS 6.5 (各項不得低於6) 以上證明。</p>	<p style="text-align: center;">韓國 Ewha Womans University</p>	<p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三級以上證明。</p>
<p style="text-align: center;">美國 Fashion Institute of Technology</p>	<p>TOEFL(iBT) 80；或 IELTS 6.5 以上證明。</p>						
<p style="text-align: center;">英國 London College of Fashion</p>	<p>IELTS 6.5 (各項不得低於6) 以上證明。</p>						
<p style="text-align: center;">韓國 Ewha Womans University</p>	<p>TOEFL(iBT)80 或 IELTS6.0；或韓檢 TOPIK 三級以上證明。</p>						
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上述各項文件經查若有偽造、假借、塗改等情事，即認定不具備報名資格。 2. 所繳交之文件及審查資料，由計畫辦公室留存備查，不予退還。 3. 學生應自行檢查所繳交之各項文件是否正確齊全，如因表件不全、資格不符、逾期繳件而遭取消報名資格，一概不受理任何形式之補救要求。 						

四、甄選方式等相關規定

組別	時尚設計組		
甄選資格	113學年度各公立大學校院大學部二年級以上，含研究所碩士班在學學生，具有中華民國國籍，且設有戶籍者。在完成國外進修培訓前，亦須具備國內學校之在學學生身分。		
培訓機構	美國 Fashion Institute of Technology	英國 London College of Fashion	韓國 Ewha Womans University
研究領域	服裝設計 時尚創意 時尚產業連結 (研究所)	男女服裝設計 織品設計 時尚產業實習 (研究所)	東方時尚 纖維紡織 時尚產業連結 (專業學程)
招生名額	1	1	1
申請方式	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」及第二階段「國內研習營」成績 初審第一階段「國內研習營申請」依據報名時繳交資料進行審查。審查通過者，擇優遴選至多共 23 名參加研習營。研習營師資由海外培訓機構代表或海外專業領域之業界代表擔任。</p> <p>國內複審： 一、繳交各海外培訓機構要求門檻之語言成績影本、3 年內之「臺灣國際學生創意設計大賽」及「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表」中所列之國際競賽(依照教育部最新公告為主，請參考附錄二，本組僅採計「綜合設計類」及「時尚設計類」獎項)得獎證明影本、申請志願表及學籍證明。繳件期限為 114 年 12 月 3 日(星期三)前，以寄出時間為憑，逾期概不受理，未繳交者，視同放棄。 二、國內複審成績計算以初審第一階段「國內研習營申請」成績(20%)+初審第二階段「國內研習營」成績(60%)+「面試」成績(10%)+「3 年內得獎證明」成績(10%)之比例合計，作為海外培訓機構志願分發之排序依據。另語言成績作為國內複審名單審查門檻，不另計分。按學員之總成績名次及志願依序分發各海外培訓機構，選送各培訓機構錄取名額最多 4 倍之送審名單；每位學員最多送審 2 所培訓機構。</p> <p>海外培訓機構決選： 海外培訓機構資料審查：合格者檢送英文作品集、英文研習計畫及英譯表件等資料，並繳交海外培訓機構要求之語文能力證明正本予承辦學校代為申請，進行決選。繳件期限依海外培訓機構申請截止日期辦理，由承辦學校另行公告之。</p>		
成績排序原則	<p>初審：第一階段「國內研習營申請」審查結果，總成績相同時，依序以 1. 「作品集」、2. 「語文成績」、3. 「其他相關證明者」之成績比較，成績較高者優先錄取。 複審：「海外培訓機構決選」合格名單審查，總成績相同時，依序以 1. 「國內研習營成績」、2. 「初審成績」比較，成績較高者優先錄取。</p>		
其他規定	學員錄取報到後，須依規定簽訂教育部「藝術與設計菁英國際進修獎學金行政契約書」始得辦理出國進修，報名時請慎重考慮自身相關因素及規定，錄取後不得以任何理由申請資格保留。		
聯絡方式	E-mail: sposad@yuntech.edu.tw; 電話: (05)534-2601 分機 6593		
計畫目標	「時尚設計」對於國家時尚產業發展具有絕對的影響。時尚設計除了能將傳統紡織工業提升到新的經濟層次外，更能藉由創新以及個人風格注入到傳統產業之中，進而做到提升國力、陶冶藝術人文發展。全球時尚產業於近一世紀的發展，造就舉世聞名的紐約、巴黎、倫敦時裝週等國際盛會，其中涉及的各项專業技術和領域知能，更代表各國文化創意產業競爭的軟實力。因此，本計畫規劃以本領域海外知名學校為合作對象，以培育更多專業優秀人才。		

附錄一 2025 年語文檢定考試資訊（本資訊僅供參考，詳細規定以考試主辦單位公告為準）

一、JLPT 日本語能力試驗

日本語能力試驗(JLPT®)係國際性測驗，可供世界各國日語學習者、日語使用者檢測日語的能力，於 1984 年開始實施，由日本國際交流基金會與日本國際教育支援協會共同舉辦。台灣考區於 1991 年開始實施，由日本台灣交流協會、日本國際交流基金會及語言訓練測驗中心主辦，一年辦理兩次，於每年 7 月及 12 月第一個週日舉行。2022 年全球共約 148 萬人報考，其中台灣考區有約 8 萬名考生。

測驗共分 5 個級數，由難至易依序為 N1 - N5。報考者可依自己的能力選擇適合的級數參加。

測驗成績可作為學習評量、入學甄選及求職時之日語能力證明，合格者可取得國際認證之合格證書。另有意赴日就讀大學者請依學校要求報考「日本留學試驗」。

- 測驗級數及測驗時間：N1、N2 在下午舉行；N3、N4、N5 在上午舉行。
- 測驗地點：台北、桃園、台中、高雄
- 測驗費：N1~N3 每名 1,600 元；N4、N5 每名 1,500 元

※欲以該檢定參與菁培計畫國內複審者，請務必報考 7 月場次。日語檢定測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。參考網址：<https://www.jlpt.tw/index.aspx>。

二、TOEFL iBT 托福網路測驗

TOEFL iBT® 托福網路測驗是透過網路連線並利用電腦進行作答的測驗，考生必需使用耳機與麥克風，並使用電腦鍵盤在電腦上回答問題，測驗考生的聽、說、讀、寫四種技巧的能力，每個測驗技巧獨立計分，分數介於 0 至 30 之間，總分於介於 0 至 120 分之間，測驗時間大約為 3 個小時，主要在評量中階(intermediate)至高階(advanced)之英語能力。

測驗內容：

測驗大題	測驗內容	測驗時間
閱讀	• 3-4 篇文章，每題組 10 題	54-72 分鐘
聽力	• 3-4 篇講課內容，每題組 6 題 • 2-3 組對話，每題組 5 題	41-57 分鐘
口說	• 4 題 1 題獨立/3 題整合能力題	17 分鐘
寫作	• 2 題 1 題獨立/1 題整合能力題	50 分鐘

TOEFL iBT® 托福網路測驗除了評量考生瞭解英語的能力，更要評量考生使用英語的能力，故題目型能為整合式出題，測驗考生如何結合聽、說、讀、寫四種技巧，以證考生能適應日後在英語系國家之課堂及校園中可能遇到的情況。

※ TOEFL iBT 測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。參考網址：

http://www.toefl.com.tw/iBT/about_main.jsp

三、IELTS 雅思國際英語測驗系統

雅思國際英語測驗是一個已獲得全球超過 11,000 個組織認可的英語考試，其中包括教育機構、公司、政府部門及專業協會等。

雅思國際英語測驗旨在評估考生在學術、高等教育或日常生活環境中的四種英語程度：聽力、閱讀、寫作、口說。

您需要參加的考試類型視您的目的而定，如果有意前往英語系國家留學，那麼您可能需要參加雅思考試-學術組 (IELTS Academic) 或英國簽證雅思考試-學術組 (IELTS for UKVI-Academic)。

雅思考試-學術組 (IELTS Academic)	英國簽證雅思考試-學術組 (IELTS for UKVI-Academic)
適合計畫前往海外大專院校留學者，包含學士、碩士、技職專校或獲得專業認證者報考。	適合計畫前往英國就讀大學預備課程 (Foundation)、語言課程 (Pre-sessional)、碩士預備課程 (Pre-Master) 及非 Tier 4 高度可信擔保方的學位課程者。

※ IELTS 雅思測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<https://ielts.idp.com/Taiwan>

<https://www.britishcouncil.org.tw/exam/ielts>

四、TCF 法語檢定測驗

TCF 為一項基本法語能力測驗，用來檢測及鑑定非法語人士的法語程度，不論是為了個人的、工作上的或是就學的目的，分為六個等級：A1/A2/B1/B2/C1/C2。TCF 效期為兩年。

測驗項目

必考科目			加考科目	
聽力：29 題共 25 分鐘	語言結構：18 題 共 15 分鐘	閱讀：29 題共 45 分鐘	口語：12 分鐘	寫作：1 小時
共 76 題選擇題：1 小時 25 分鐘				

考試報名方式

現場報名	線上報名
現場報名請準備護照或身份證件正本、大頭照 JPEG 檔、填寫線上報名表單並至台北中心繳交費用。	<ol style="list-style-type: none">1. 點選下方「線上報名表單」，完整、確實填寫並提交2. 依照指示建立帳號3. 確認表單無誤後將於「三至五個非假日工作天」以電子郵件主動寄發線上付款連結4. 進行線上付款5. 收到電子付款收據即成功報名

考試注意事項

考試請攜帶考生最晚應於考前 10 分鐘進入考場準備

准考證、身份證或護照(其餘證件概不受理)以及黑色原子筆應考

※ TCF 法語檢定測驗測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

<https://www.alliancefrancaise.org.tw/services/tcf-zh/>

五、DELF-DALF®官方法語鑑定文憑

DELF / DALF 為法國教育部唯一認可的官方法語鑑定文憑。

本測驗(DELF-DALF Tout public 大眾版)依據歐洲語言共同參考架構，共分 6 個級數，由難至易依序為 C2-C1-B2-B1-A2-A1。報考者可依自己的能力選擇適合的級數參加。DELF / DALF 鑑定文憑終生有效。同一級數通過者即無法再次報考，例如已通過 DELF PRO B1 者，之後只能報考 DELF(大眾版)A1/A2/B2/C1/C2 級數考試。

本測驗成績為法國高等教育申請入學門檻，自 2008 年起，如欲申請大學且擁有 DELF B2 鑑定文憑，無需參加其他法語測驗。

相關資訊請查閱臺灣法國文化協會，網址：<http://www.alliancefrancaise.org.tw/>。

DELF / DALF 所有試題之設計皆經過嚴謹程序審核(由法國國際教學研究人員評估、審核及制定)；而測驗中所有試題委員、閱卷官與口試官皆受過專業訓練並獲適任證明。各級數皆包含以下四類型測驗：(1)聽力測驗 (2)閱讀測驗 (3)寫作測驗 (4)口說測驗

臺灣法國文化協會台北中心與高雄中心每年皆會舉辦數場法語鑑定考試。

報名截止日期為每場考試前八週，詳細內容、報名期限及辦法等都會公布在協會網站上。

考生可自由選擇所要報考的級數。各級別的法語鑑定文憑為各自獨立的文憑，所以報考者可依據自己的程度報考。(舉例來說，若要報考 B1 級數，毋需先通過 A1 或 A2 級數)。且同一梯次測驗(若測驗時間無衝突)，考生可同時報考不同級數之測驗；若報考之測驗級數皆通過，將會拿到各別的法語鑑定文憑。

※法語檢定測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<https://www.alliancefrancaise.org.tw/services/delf-dalf-zh/>

六、德語考試 Goethe-Institute

(一) 歌德 A1 級德語檢定考試 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

歌德 A1 級德語檢定是成年人的德語考試。它證明考生已懂得基本的德語，並獲得《歐洲共同語言參考框架》(GER)規定的六級能力等級的第一級語言等級 (A1)。

考試內容包括閱讀，聽力，寫作和口語考試 (口語考試是小組考試)。

1. 閱讀 (25 分鐘)
需要閱讀簡短的便條，分類廣告，個人的描述，標誌或告示，以及回答問題。
2. 聽力 (20 分鐘)
將聽到簡短的日常對話，電話留言或公共揚聲器的廣播，並回答問題。
3. 寫作 (20 分鐘)
需要填寫簡單的表格，並撰寫有關日常情況的簡短文章。
4. 口試 (15 分鐘)
進行自我介紹，然後詢問並回答日常生活中的問題，並向小組中的某人詢問一些事情。

(二) 歌德 B1 級檢定考試 Goethe-Zertifikat B1

歌德 B1 級德語檢定是針對青少年和成年人的德語考試。它證明考生已能獨立使用德語，並獲得《歐洲共同語言參考框架》(GER)規定的六級能力等級的第三級語言等級 (B1)。要達到此水平，您需要上 350 至 650 節課，每節 45 分鐘。上課時間長短具體取決於先前的德語知識。

考試內容考試包括閱讀，聽力，寫作和口語考試。該考試是全球統一進行，並且進行評估。考生可以選擇單獨考其中一部分或整個考試。四個部分的證書等於一個完整的證書。該考試由歌德學院，瑞士弗萊堡大學和 ÖSD 聯合開發，並在全球命名為 Goethe-Zertifikat B1 和 ÖSD-ZertifikatB1。

1. 閱讀 (65 分鐘)
需要閱讀博客文章，電子郵件，報紙文章，廣告和書面說明。您可以獲得關鍵信息，重要細節以及觀點和意見。
2. 聽力 (40 分鐘)
收聽收音機的公告，短演講，非正式會談和討論。
3. 寫作 (65 分鐘)
需要撰寫個人和正式的電子郵件/信函，並在論壇帖子中以書面形式表達您的意見。
4. 口試 (15 分鐘)
與對話者談論日常生活中的話題，例如：旅行。這樣，您可以對問題發表意見並提出建議。您們自由地討論日常生活中的某個主題，並回答有關問題。

※歌德檢定考試約每 1 至 2 月舉辦一次，實際測驗日期請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。參考網址：<http://www.goethe.de/ins/cn/cn/tai/lrn/prf/tdt.html>

七、TOPIK 韓國語言能力測驗

測驗目的

1. 為母語非韓國語之韓語學習者、韓國僑民、外國人提供學習方向；並祈達到普及韓語之效。
2. 測試和評量韓國語使用能力，並以此為留學韓國或就業的依據。

測驗級數及測驗費

1. 測驗級數：TOPIK I、TOPIK II
2. 依據測驗成績又可分為六等級(1~6 級)
3. TOPIK I 為舊制初級、TOPIK II 為舊制中、高級
4. TOPIK I 測驗費 NT\$1,100、TOPIK II 測驗費 NT\$1,400

測驗級數	TOPIK I		TOPIK II			
成績等及 判定	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
	80 分以上	140 分以上	120 分以上	150 分以上	190 分以上	230 分以上

※ TOPIK 韓國語言能力測驗日期，請至應考單位官方網站查詢，並及早準備。

參考網址：<https://www.topik.go.kr/TWMAIN/TWMAIN0010.do>

<https://www.topik.com.tw/>

附錄二 教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽一覽表

一、綜合設計類：

1. 德國紅點設計獎 Red Dot Design Award	第一等
2. 美國國際設計傑出獎 International Design Excellence Awards (IDEA)	第一等
3. 德國 iF 設計獎 iF Design Award	第一等
4. 英國設計與藝術指導協會新血獎 D&AD New Blood Awards	第一等
5. 奧地利國際電子藝術競賽 Prix Ars Electronica-International Competition for CyberArts	第一等
6. 英國倫敦國際獎 London International Awards	第一等
7. 日本 G-Mark 設計獎 Good Design Award (G-Mark)	第一等
8. Adobe 卓越設計大獎 Adobe Design Achievement Awards (ADAA)	第一等
9. 紐約藝術指導協會年度獎 New York Art Directors Club Annual Awards	第一等

二、產品設計類：

1. 德國 iF 獎 iF Design Award	第一等
2. 德國百靈國際設計大賽 BraunPrize International Design Award	第一等
3. 德國紅點設計獎 Red Dot Design Award	第一等

三、視覺傳達設計類：

1. 波蘭華沙國際海報雙年展 International Poster Biennale in Warsaw	第一等
2. 捷克布魯諾國際平面設計雙年展 International Biennale of Graphic Design in Brno	第一等
3. 日本富山國際海報三年展 International Poster Triennial in Toyama	第一等
4. 法國蕭蒙國際海報節國際競賽學生展 Students, All to Chaumont' Poster Competition	第一等

5. 義大利波隆那國際兒童書插畫展 Bologna Children' s Book Fair - Illustrators Exhibition	第一等
6. 墨西哥國際海報雙年展 International Poster Biennial in Mexico (BICM)	第一等
7. 英國設計與藝術指導協會新血獎 D&AD New Blood Awards	第一等
8. 英國倫敦國際獎 London International Awards	第一等
9. 美國傳達藝術年度獎 Communication Arts	第一等
10. 芬蘭拉赫第國際海報三年展 Lahti International Poster Triennial	第一等
11. 美國 One Show 獎 The One Show	第一等
12. 東京 TOKYO TDC 字體設計競賽 Tokyo Type Directors Club Annual Award	第一等
13. NY TDC 紐約字體設計競賽 NY TDC Awards	第一等
14. 莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎 Golden Bee Global Biennale of Graphic Design	第一等

四、數位動畫類：

1. 美國 ACM SIGGRAPH 電腦動畫展 ACM SIGGRAPH Computer Animation Festival	第一等
2. 荷蘭 Kaboom 動畫影展 Kaboom Animation Festival	第一等
3. 加拿大渥太華國際動畫影展 Ottawa International Animation Festival	第一等
4. 法國安錫動畫影展 Annecy International Animation Film Festival	第一等
5. 德國柏林短片影展 International Short Film Festival Berlin	第一等
6. 奧地利國際電子藝術競賽 Prix Ars Electronica-International Competition for CyberArts	第一等
7. 英國倫敦國際獎 London International Awards	第一等
8. 韓國富川國際學生動畫影展 Bucheon International Student Animation Festival	第二等
9. 日本廣島國際動畫影展 International Animation Festival Hiroshima	第二等

10. 澳洲墨爾本國際動畫影展 Melbourne International Animation Festival	第二等
---	-----

五、工藝設計類：

1. 德國 TALENTE 國際競賽展 TALENTE	第一等
2. 日本美濃國際陶藝競賽(三年展) International Ceramics Competition MINO, Japan	第一等
3. 義大利法恩扎當代國際陶藝獎(雙年展) International Competition of Contemporary Ceramic Art	第一等
4. 韓國國際陶瓷雙年展 Korean International Ceramic Biennale (KICB)	第一等
5. 日本伊丹國際當代首飾(工藝)展 ITAMI International Contemporary Jewellery(Craft) Exhibition	第一等
6. 德國杜塞道夫「Friedrich Becker」獎 Friedrich Becker Preis Düsseldorf	第二等
7. 韓國清州國際工藝大賽(雙年展) Cheongju Craft Biennale	第二等

六、建築與景觀設計類

1. IFLA 學生國際景觀建築設計競賽 IFLA STUDENT LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN COMPETITION	第一等
2. Archiprix 全球建築畢業設計大獎(雙年獎) Archiprix International	第一等
3. OISTAT 國際劇場建築競賽 OISTAT Theatre Architecture Competition	第二等
4. RIBA 英國皇家建築師學會會長獎 RIBA Presidents Medals Students Award	第一等
5. ISARCH 建築學生獎 ISARCH Awards for Architecture Students	第二等
6. eVolo 摩天大樓設計競賽 eVolo Skyscraper Competition	第二等
7. 日本中央玻璃國際建築設計競賽 Central Glass International Architectural Design Competition	第二等
8. IFLA 亞太區學生國際景觀建築設計競賽 IFLA APR Student Design Competition	第二等
9. 美國建築大師獎 The Architecture Master Prize (AMP)	第三等
10. VELUX 國際建築設計競賽	第二等

International VELUX Award	
11. IIDA 國際室內設計協會學生設計競賽 IIDA Student Design Competition	第三等

七、時尚設計類

1. 法國路易威登精品大賽 LVMH Prize	第一等
2. 世界可穿著藝術大賽 World of WearableArt Awards Show (WOW)	第二等
3. 義大利國際人才支持獎 International Talent Support (ITS)	第一等
4. iD 國際新銳設計師獎 iD International Emerging Designer Awards	第一等
5. 洛茲國際織錦三年展 International Triennial of Tapestry (ITT)	第一等
6. 名古屋時裝大賽 Nagoya Fashion Contest	第二等

【最近修訂】民國 112 年 02 月 03 日臺教高（一）字第 1122200110A 號

附錄三 國立雲林科技大學位置圖



自行駕車

●南下：

- 國道一號 (中山高) → 斗南交流道 → 台一線 238K → 斗六 → 本校 (約 8 分鐘)
- 國道一號 (中山高) → 西螺交流道 → 荊桐 → 斗六 → 本校 (約 20 分鐘)
- 國道三號 (南二高) → 斗六交流道 → 斗六 → 本校 (約 10 分鐘)

●北上：

- 國道一號 (中山高) → 斗南交流道 → 台一線 238K → 斗六 → 本校 (約 8 分鐘)
- 國道一號 (中山高) → 大林交流道 → 斗南 → 台一線 238K → 斗六 → 本校 (約 25 分鐘)
- 國道三號 (南二高) → 古坑交流道 → 東西向快速道路 78 → 斗六 → 本校 (約 8 分鐘)

搭乘大眾交通工具

本校備有校車、雲林高鐵、斗火車站至本校之各種客運、接駁車，詳細資訊請至下列網址查詢：

<https://www.yuntech.edu.tw/index.php/2019-08-20-05-41-18>

附錄四 台南應用科技大學位置圖



台鐵

- (1) 台鐵台南站：可搭 5 號、21 號公車至鹽行站，由中正路步行至本校約 3 分鐘，或搭計程車到校(約 20 分鐘)。
- (2) 台鐵永康站：可搭 20 號公車至台南應用科大站，或搭計程車到校(約 10 分鐘)。

高鐵(台南站)

- (1) 可搭高鐵快捷公車(奇美線)至鹽行站，由中正路步行至本校約 3 分鐘，或搭計程車至本校。
- (2) 可搭台鐵沙崙站區間車至台南火車站，再轉搭 5 號、21 號公車至鹽行站，由中正路步行至本校約 3 分鐘。
- (3) 可搭台鐵沙崙站區間車至永康火車站，再轉搭 20 號公車至台南應用科大站。

客運

南下可搭統聯、和欣及國光客運往台南，至鹽行站下車，由中正路步行至本校約 3 分鐘。

高速公路

※北上車輛

- (1) 國道 1(中山高)北上 320 公里處由永康交流道下，往台南市區方向約 1 公里即達本校。
- (2) 國道 3(南二高)→新化系統轉接國道 8→台南系統轉接國道 1(中山高)往台南方向，於南下 318 公里處由永康交流道下，轉往台南市區方向約 1 公里即達本校。
- (3) 國道 3(南二高)→關廟系統下→轉機場聯絡快速道路(86 號)西行→接中山高速公路往北上→永康交流道下往台南市區方向約 1 公里即達本校。

※南上車輛

- (1) 國道 1(中山高)南下 318 公里處由永康交流道下，右轉往台南市區方向約 1 公里即達本校。
- (2) 國道 3(南二高)→新化系統轉接國道 8→台南系統轉接國道 1(中山高)往台南方向，於南下 318 公里處由永康交流道下，右轉往台南市區方向約 1 公里即達本校。

附錄五 國立成功大學位置圖



自行開車 (國道路線)	<p>【南下】 沿國道一號南下 → 下永康交流道右轉 → 沿中正北路、中正南路 (南向) 往台南市區直行 → 中華路左轉 → 沿中華東路前進 → 於小東路口右轉, 直走即可抵達本校。 ※自國道三號南下者, 轉國道 8 號 (西向), 可接國道一號 (南向)</p>
	<p>【北上】 沿國道一號北上 → 下仁德交流道左轉 → 沿東門路 (西向) 往台南市區直走 → 遇林森路或長榮路右轉 (北向), 即可抵達本校。 ※自國道三號北上者, 轉 86 號快速道路 (西向), 可接國道一號 (北向)</p>
搭乘火車	於台南站下車後, 自後站出口 (大學路), 大學路左側即為本校光復校區。
搭乘高鐵	搭乘台灣高鐵抵台南站者, 可至高鐵台南站二樓轉乘通廊或一樓大廳 1 號出口前往台鐵沙崙站搭乘台鐵區間車前往台南火車站, 約 30 分鐘一班車, 20 分鐘可到達台南火車站; 成功大學自台南火車站 <u>後站出口</u> 步行即可到達。

申請人姓名：_____；推薦人姓名：_____

一、申請人在下列項目表現：

評估項目	極佳 (前 5%)	甚佳 (5%-10%)	佳 (10%-25%)	尚可 (25%-50%)	差 (50%以下)	資訊不足
自動自發的態度						
成熟與穩定度						
獨立工作能力						
共事能力						
表達能力						
領導能力						
邏輯分析能力						
專業知能						
創新能力						
研究潛能						
整體總評						

二、申請人的求學與工作態度：

積極主動 嚴謹小心 尚可 消極被動 無從判斷

三、依申請人的表現，具有之特殊研究能力，相關之優缺點，及未來發展潛力，請說明：

四、綜合上列評估，推薦對申請者申請計畫所持態度：

極力推薦 推薦 勉強推薦 不推薦 無從判斷

推薦人簽名：_____年 月 日

本表完成後，請簽名並上傳至線上平臺。